

横放電型 N₂ ガスレーザーの試作

巴 根*, 大森 健三, 大石 正和, 斎藤 博

岡山理科大学応用物理学科

(昭和58年9月20日 受理)

1. まえがき

紫外域窒素レーザーは、Heard¹⁾によって、最初に発振が実現されて以来、紫外域波長で、ナノ秒パルスの発振が得られ、しかも、高速繰返し発振が得られることから、いろいろな改良や研究がなされてきた。特に、色素レーザーの励起光源として、また、半導体の高密度励起や有機化合物の電子状態の研究に、幅広く利用されている。紫外域窒素レーザー装置の製作については、いくつかの報告が、既になされている。²⁾ 構造上の特徴から大別すると、放電励起の場合、レーザー管、スパークギャップ、コンデンサーを、同軸構造にした同軸型。³⁾ LC 反転回路を用いた横放電型⁴⁾ (TE 型: Transverse Excitation). Blumlein 型⁵⁾ がある。同軸型は、比較的小型で低出力であっても、高速繰返しを要する場合に用いられ、横放電型は主として、大型で高出力を必要とする場合に用いられている。

放電励起以外の励起方法で、高効率のものが開発されており、最近注目されているものもある。

我々は、製作が、容易な上に、高出力が得られ、繰返し発振が可能で、実験に充分使用できる装置として、横放電型窒素レーザーを選び、試作したので、ここに、その製作過程を中心に報告し、窒素ガスレーザーの動作並びに、その特性についても言及する。

2. 横放電型窒素ガスレーザーの構造

2-1 レーザー管

製作したレーザー管の構造を図1に示す。レーザー管本体と放電電極には、種々の材質の検討と工夫がなされているが、今回、試作したレーザー管は、図1に示すように、電極をはさんだ箱型管で、上下板は、厚さ10mmのポリカーボネート板で、電極の座になる側板は、厚さ25mmのアルミニウム板である。そして電極はL型アルミニウムアングルを加工して作った。電極の取替えや、保守の便宜を考えて、全部ネジ止め構造をしている。レーザー管の真空漏れを、防止するため、側板と上下板の接合部に、半径3.5mmの真空用Oリングを利用した。レーザー管の両端に、アクリル製フランジをシリコン系ゴム糊

*現住所：中国内モンゴル自治区通遼市内蒙民族師範学院

(信越シリコーン, KE 45) で、パッキングして(アクリルフランジの接合面上に、幅 3 mm, 深さ 2 mm 程度の溝を掘り、シリコンゴム糊を均等に溢れる程度まで注入した。) ネジ止めした。またフランジと石英窓ガラス枠との間の接合には、真空用 O リングを使用した。これは、窓ガラスの調整が可能となるように工夫した。レーザー出力光の窓には、厚さ 2 mm の透明石英ガラス板を用い、シリコン系ゴム糊で、枠に張り付けた。

放電管の電極の長さは、使うコンデンサーの形状、容量の関係で、50 cm にし、先端を直径 5 mm の半円形にした。アーク放電防止のため、電極の両端は勿論、ネジ止めの穴の部分等に、尖った個所のないように配慮して、加工した。

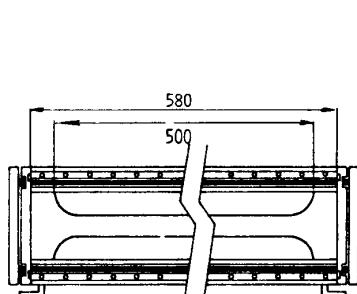


図1 N₂ガス放電管の構造 (単位 mm)

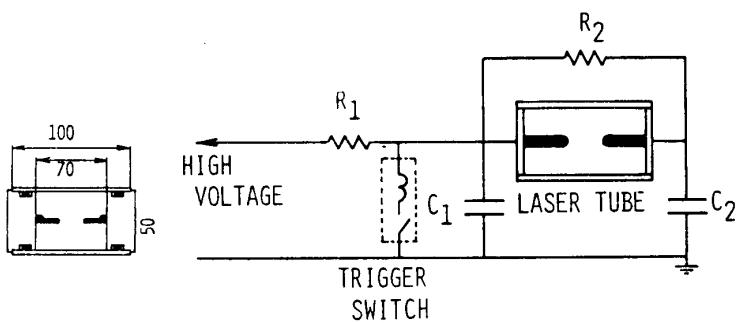


図2 Blumlein 回路

2-2 高圧放電用コンデンサー

紫外域窒素レーザーの上準位の寿命は、下準位より約 2 術短く、40ns である。そこで、立上り時間が短く損失の小さい起動スイッチと、伝送路を用いて、この寿命より短いナノ秒電流パルスを使って、励起を有効に行う必要がある。また、このようにして、大電流の放電を行わせることは、電子密度を高めて、励起効率を上げるのにも有効である。²⁾ 以上の事柄を考慮し、窒素ガス分子の励起に用いる高電圧パルスは、高圧放電用のコンデンサーに充電した高電圧を、トリガースイッチによって素早くスイッチングする方法で得ることにした。図2に、高圧放電用コンデンサー、トリガースイッチ、放電管等からなる Blumlein 回路を示す。このような回路は、次のような特性が要求される。

- ① 放電管にかかる電圧は、短時間 (<40ns) で立上ること。即ち、回路のインダクタンスが十分小さいこと。
- ② コンデンサーには、高い充電電圧が、加わるため十分な絶縁耐圧があること。また、大きなエネルギーを蓄えるため、容量が十分大きいこと。

以上の条件を考慮し、コンデンサーを次のようにして作った。コンデンサーの誘電体材料として、マイラー(ティジンテトロンフィルム、厚さ 100 μm、誘電率 3.1) を用い、これを、厚さ 75 μm の電解銅フォイル一枚と片面プリント基板とで、はさんで形成した。

コンデンサーの一方の極板をプリント基板にしたのは、コンデンサーの形状を、しっかりさせると共に、取扱い易さという利点があるからである。また、誘電体薄板中のボイド(void) による絶縁破壊防止のため、厚さ 100 μm のマイラーを三枚用いて貼り付けた。マ

イラーと電極板とを、貼り付ける際には、スプレー接着剤(住友スリーエムスプレー糊55)を用い、むら無く吹き付け、気泡が極力入らないように注意する必要がある。コンデンサーの極板の端で、電界の集中による絶縁破壊を防ぐため、図3に示すように、銅箔の端を丸めて、シリコンゴム糊で埋込み、プリント基板の端も、シリコンゴム糊で覆った。

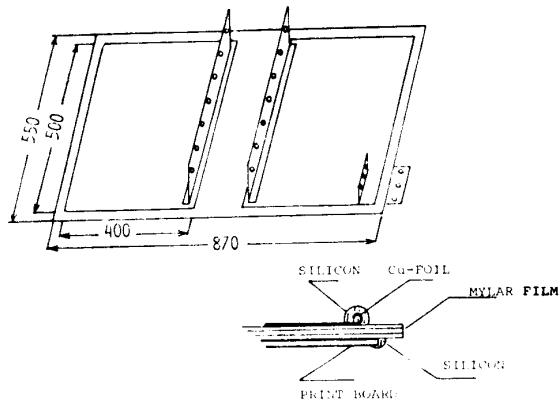


図3 下部極板構造とコンデンサー端面の処理 (単位 mm)

本装置では、レーザー管の側板が直に、放電管の電極の一部になっている。これは、特性インピーダンスを、小さくするためと、組立てや取外し修理の便宜を計ったためである。そこで、コンデンサーと放電管側板の連結に厚さ 1 mm の真鍮を用いた。この真鍮板とコンデンサーの極板とは、低温ハンダで、一方、放電管の側板とは、ネジ止めで、接続した。

トリガースイッチの高圧側とコンデンサーとの連結にも同様の工夫をした。

コンデンサーの誘電体として用いたマイラーの絶縁破壊電圧は、6.2 kV/25 μm である。従って、今回製作したコンデンサーは、厚さ 100 μm のマイラーを三枚重ねて作っているので、計算上は、74.4 kV となる。絶縁破壊電圧のテストは、行っていないが、20 kV 程度までは、十分に使用可能であった。また、マイラーの誘電率は 3.1、極板の面積は 2000 cm² であるから、コンデンサーの容量は $C_1 = C_2 = 35.4 \text{ nF}$ となる。

2-3 トリガースイッチ

トリガースイッチとしては、繰返し速度の調整が可能であること、大電流のスイッチングによる耐久性とが、必要である。そこで、我々は、摩耗の激しい、スパークギャップ電極を、ステンレスで製作し、交換が容易に出来るようにネジ止めにした。また、スパークギャップの高圧側電極には、電極の中央に窒素ガス導入口を設け、窒素ガスを常に 0.5~2 気圧に保ち、安定したスイッチングを行わせるとともに、トリガー電極の酸化防止を計った。図4に示すように、トリガーには、スパーク・プラグを用い、絶縁体兼フードとして、内径 47 mm φ のアクリル管を用いた。

トリガーパルス発生回路を、図5に示す。トリガーパルスの繰返しの調整は、トリガーパルス回路にある時定数を決定する、可変抵抗の調整によって行った。

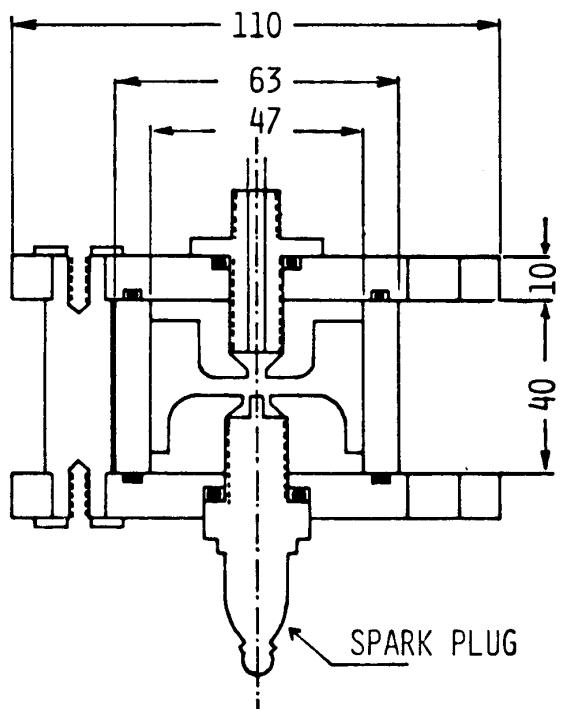


図4 トリガースパークギャップの構造(単位mm)

2-4 窒素ガス給排系

窒素ガスは、窒素ガスボンベから、減圧弁（ニードルバルブ付のもの）を通してレーザー管に導入し、レーザー発振に適したガス圧になるように、レーザー管内の窒素ガスを油回転ポンプ（排気速度が330 l/min）で排気した。レーザー管中のガス圧測定は、ガス導入口と、出口での圧力を測定し、その平均圧力を放電管中の圧力とした。圧力の測定には、水銀マノメーターを用いた。また、トリガスイッチ内への窒素ガス導入は、レーザー管への導入と違った系で行った。トリガースイッチ内の窒素ガスは、実験前に、一度ガス導入しておけば、余程のガス漏れが無い限り、十分使用に供せた。

3. 試作窒素レーザーの特性

レーザー出力とパルス繰返しの測定は、サーモパイロパワーメーター（Scientech, inc. Model 360001）及び、PIN ホトダイオード（YHP 4220）とオッショロスコープ（YHP 1740 A 100 MHz）とを使って行った。

3-1 レーザー出力の放電管中窒素ガス圧、印加電圧依存性

図6に繰返しパルス一定で、放電用コンデンサーに印加した高電圧をパラメーターとした、出力強度とレーザー管内窒素ガス圧との依存性を示す。図6より、窒素レーザーでは、同じ電圧で発振できるレーザー管中の窒素ガス圧に、上限と下限とがあることが、見出される。

これは、Cartwright⁷⁾による窒素分子のエネルギー準位と基底状態からの励起断面積との関係（図7）より定性的に解釈することができる。つまり、窒素ガス圧が低ければ、励

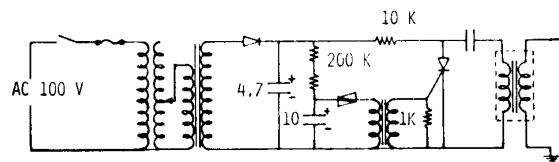


図5 トリガーパルス発生回路

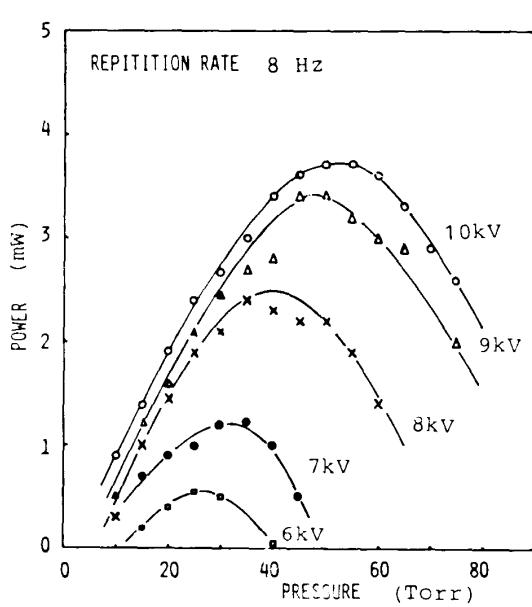
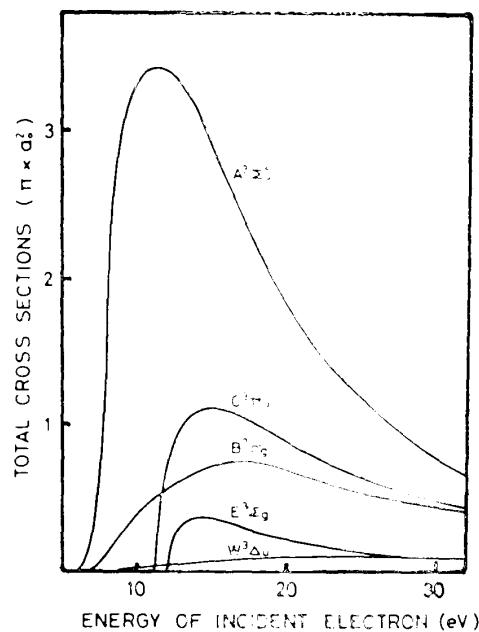
図6 レーザー出力とN₂ガス圧力

図7 入射電子エネルギーと全断面積

起電子の平均自由行程が長くなり励起電子のエネルギーが大きくなるので C³Pu 準位の励起断面積が減少し、B³Pg 準位との間の反転分布も減少するので、レーザー出力が低下する。一方、窒素ガス圧を高くすれば、平均自由行程が短くなり、励起電子のエネルギーは減少する。この時、窒素分子の C³Pu 準位の励起断面積が減少するので、レーザー出力が低下する。また、図6より最適プラズマ・パラメーター E/P を計算した結果は、204V/cm・Torr で、理論値⁸⁾の 250V/cm・Torr にかなり近い値が得られた。

3-2 レーザー出力強度のパルス反復率依存性

電源電圧を一定にし、放電管内窒素ガス圧をパラメーターとして、one pulse 当りの出力強度のパルス反復率依存性を測定した。図8にその結果を示す。出力強度は、パルス反

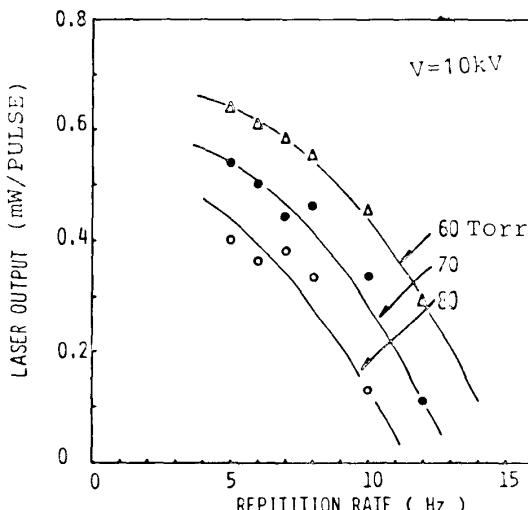


図8 レーザー出力と反復率

復率の増加に伴い、低下する傾向が見られる。この原因としては、高圧電源の容量や、コンデンサーへの充電時定数による繰返し周波数の制限が考えられる。しかし、発振が停止した周波数でも、グロー放電は存続していること、及び、 N_2 ガスの流量を増すと発振光が強くなるという事実から、一度励起された N_2 ガスが、次の励起が行われる前に完全に、放電管から排出されていないことによる。

$B^2\Pi g$ 状態から、基底状態 $X'\Sigma g^+$ への緩和を促進し、出力改善をはかるために、 SF_6 を N_2 ガスに混合することも行われている。⁹⁾現段階で、改善すべきことは、放電管のコンダクタンスを大きくすること、即ち、放電管への N_2 ガスの給排系を、検討し効率的にガスの置換が行えるようにすることが、必要である。我々の製作したレーザーでは、充電用抵抗が、 $100k\Omega$ で、最大繰返し周波数 16Hz で発振可能である。

3-3 窒素レーザーのパルス時間幅

我々は、正常発振している窒素ガスレーザー光を、光検出器 (YHP の PIN ホトダイオード) で検出し、オシロスコープ (SONY Tektronix 485 型 350 MHz) で、そのパルス波形を観測した。

図9に示す写真は、約 300 パルスを、露光したものである。これより、パルス時間幅は、約 6 ns, time zitter は 1 ns 以下である。また、強度の変動は、約 7 %以下におさまっていて、十分に光物性の実験に供せられる安定性を有している。さらに、電気的 noise も少なく、他の測定器に及ぼす影響も少ない。

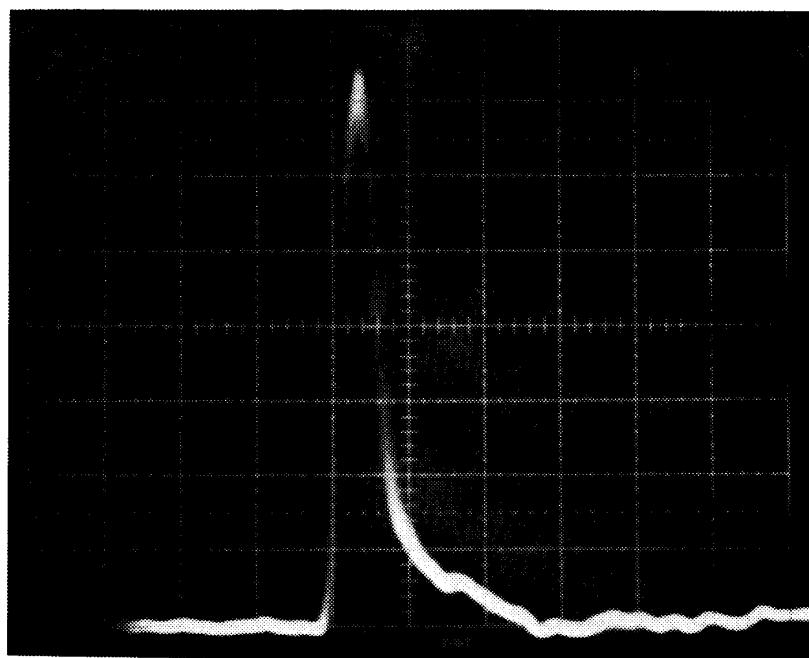


図9 レーザー発振光のパルス波形 (10 ns/DIV)

3-4 窒素ガスレーザー発振スペクトル

分光器 (JOBIN YVON HR-1000), フォトマルチプライヤー(浜松ホトニクス R-562), の組合せにより、発振スペクトルを測定した。その結果を図10に示す。このスペクトルは、

3371 Åを中心とする何本かのスペクトル線からなっているが、顕著な三つのピーク波長は、それぞれ、3370.8 Å, 3371.1 Å, 3371.4 Åとあることがわかった。

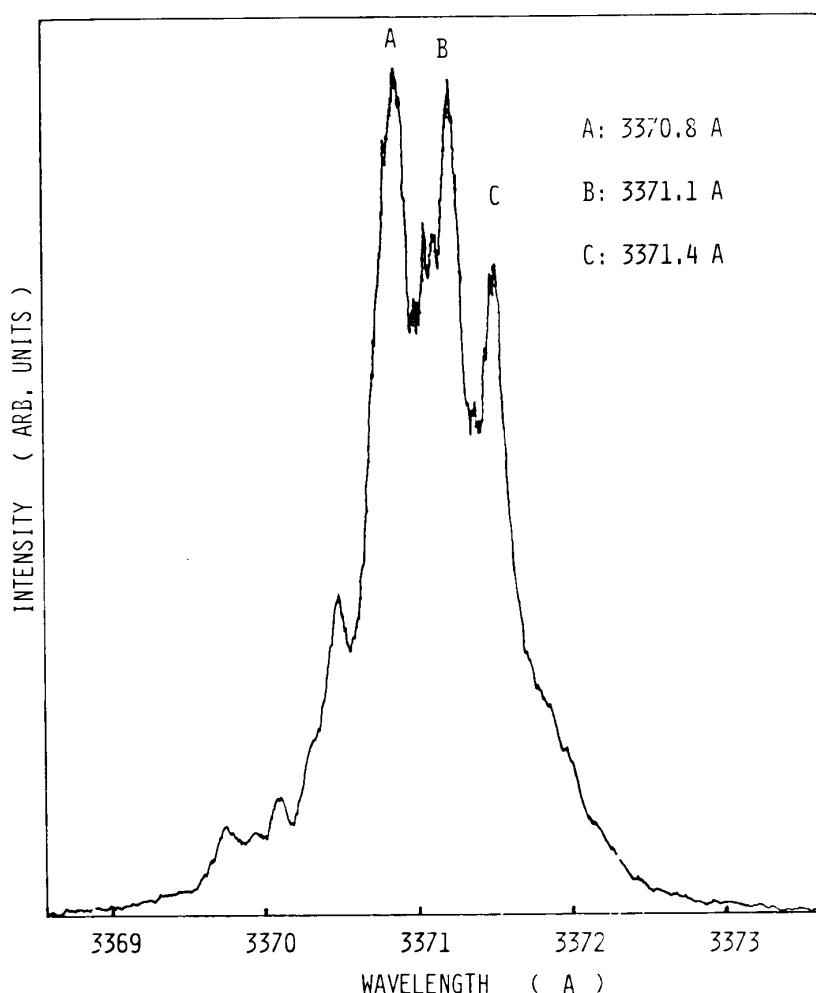


図10 3371A 近傍のスペクトル

今回の実験で、電源電圧 10kV での最高出力は、放電管内窒素ガス圧 55 Torr, 繰返し 8 Hz で動作させた場合、パルス幅が 6 ns で、約 150 kW のピーク出力を得た。これらの特性は、色素レーザー励起光源及び、紫外光源として、光物性の測定に十分耐えうるものである。

以上の結果から、試作した横放電型窒素レーザー装置についての特徴は

- (1) 構造が比較的簡単で、取扱い並びに、保守が容易である。
- (2) レーザー発振は、比較的安定で、電気的 noise が少ない。
- (3) 出力が比較的大きい。
- (4) 励起電圧が高いほど、また、繰返しパルスが、遅いほど、出力が大きいが、コンデンサーの絶縁性による限界がある。

などである。

レーザー発振の効率は、今回試作したものについては0.18%と見積られ、既発表の値⁵⁾と比べて、遜色ないが、今後、さらに高効率化を計ってゆく必要がある。最後に、今回作成したレーザーの外観（高圧電源を除く）の写真を図11に示す。

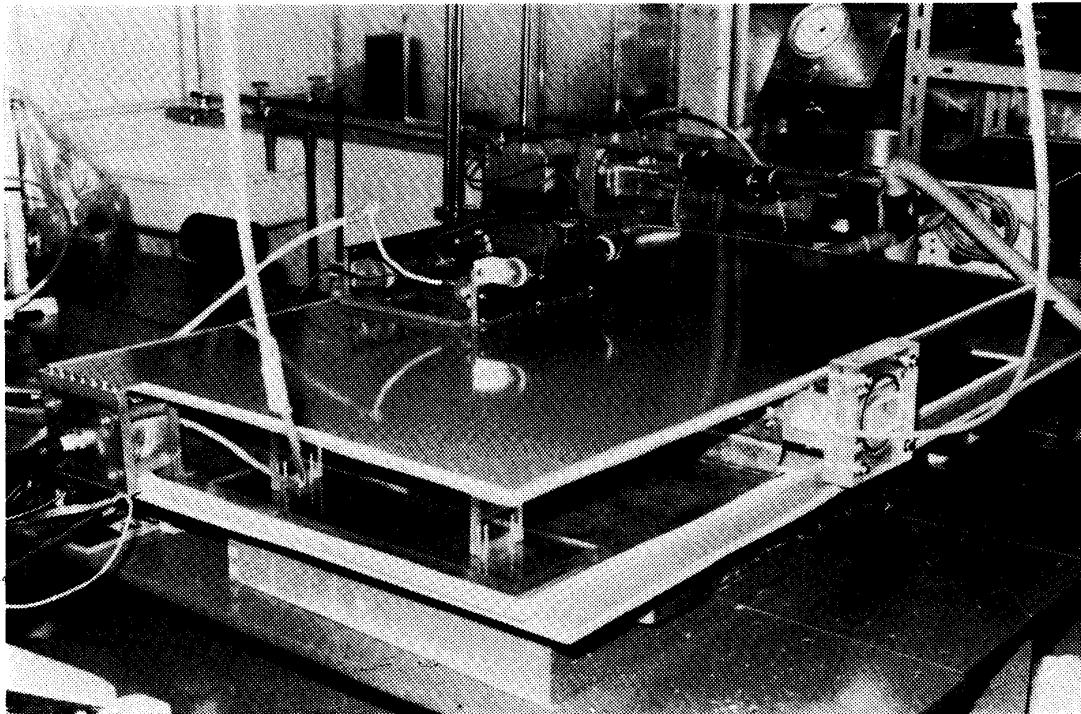


図11 試作レーザーの外観

References

- 1) H. G. Heard : Nature 200 (1963) 667
- 2) 例えば 石田祐三, 矢島達夫 : 応用物理 第46巻 第16号 (1977) 996
小黒洋一 : 長岡技術科学大学修士論文 (1982)
Y. Mizumoto and C. Yamanaka : Techno. Rep. Osaka Univ. 20 (1970) 131
- 3) M. Geller, D. E. Altman and T. A. Detemple : J. Appl. Phys. 37 (1966) 3639
- 4) D. A. Leonard : Appl. Phys. Letters 7 (1965) 4
- 5) J. D. Shipman Jr. : Appl. Phys. Letters 10 (1967) 3
D. Basting, F. P. Schafer and B. Steyer : Optoelectronics 4 (1972) 43
B. Godard : IEEE. J. Quant. Electron. QE-10 (1974) 147
- 6) E. L. Patterson, J. B. Gerardo and A. Wayne Johnson : Appl. Phys. Letters 26 (1975) 619
- 7) D. C. Cartwright : Phys. Rev. A 2 (1970) 1331
- 8) 田中省作, 川見繁, 小林洋志, 笹倉博 : 鳥取大学工学部研究報告 第6巻 第一号 (1976) 148
- 9) J. I. Levatter and S. C. Lin : Appl. Phys. Letters, 25 (1974) 174
C. S. Willett and D. M. Litynski : Appl. Phys. Letters 26 (1975) 118
S. H. Suchard, L. Galvan and D. G. Sutton : Appl. Phys. Letters 26 (1975) 521
- 10) J. H. Parks : Appl. Phys. Letters 13 (1968) 143

TE-TYPE UV N₂ GASS LASER

Bagan*, Kenzo OHMORI, Masakazu OHISHI and Hiroshi SAITO

*Departement of Applied Physics, Okayama University of Science,
Ridai-cho, Okayama 700, Japan*

(Received September 20, 1983)

The process of constructing the TE (Transverse Excitation)-type UV N₂ gass laser and some characteristics were reported. The laser pulse duration was about 6 ns and peak fluctuation was less than 7 %. The maximum peak power was 150 kW at repitition rate 8 Hz, N₂ gass pressure 55 Torr and charging voltage 10kV. The optimum plasma parameter and the efficiency were estimated as 204 V/cm·Torr and 0.18 %, which are comparable to previously reported. The spectrum around 3371 Å are composed of many lines, however the prominent lines were identified as 3370.8 Å, 3371.1 Å and 3371.4 Å, respectively.

*present address : Teachers' College of Inner Mongolians, Inner Mongolia Tong Lio City,
The People's Republic of China